

- [4] Басаргин И.В., Мишин Г.И. Препринт № 880 ФТИ АН СССР. Л., 1984. 22 с.
- [5] Басаргин И.В., Мишин Г.И. // Письма в ЖТФ. 1985. Т. 11. № 4. С. 209-215.
- [6] Грачев Л.П., Есаков Н.И., Мишин Г.И. и др. // ЖТФ. 1985. Т. 55. № 5. С. 972-975.
- [7] Мишин Г.И. // Письма в ЖТФ. 1985. Т. 11. № 5. С. 274-278.
- [8] Басаргин И.В., Мишин Г.И. // Письма в ЖТФ. 1985. Т. 11. № 21. С. 1297-1303.
- [9] Горшков В.А., Климов А.И., Мишин Г.И., Федотов А.Б., Явор И.П. // ЖТФ. 1987. № 10. С. 1893-1898.
- [10] Держиеев В.И., Жидков А.Г., Яковлеко С.И. Излучение ионов в неравновесной плотной плазме. М.: Энергоатомиздат, 1986. 106 с.
- [11] Ingard U. // The Physical Review. 1966. V. 145. N 1. P. 41-46.

Поступило в Редакцию
9 марта 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 15, вып. 8

26 апреля 1989 г.

06.3; 07

ФОТОИНДУЦИРОВАННОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ
В ОПТИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДАХ НА ОСНОВЕ
ЛЕГИРОВАННОГО ТИТАНАТА ВИСМУТА ($\text{Bi}_{12}\text{TiO}_{20}$)

В.М. Абусев, Е.И. Леонов,
А.А. Липовский

В последние годы в системах записи, хранения и обработки оптической информации широко применяются монокристаллы типа силленитов [1, 2]. Изучение фотоиндукции поглощения света (ФИП) в таких монокристаллах позволяет существенно расширить представление об их энергетической структуре и возможностях воздействия на нее. Эффект ФИП также может быть использован при построении оптических устройств, управляемых светом. Большой интерес представляет реализация ФИП в оптических волноводах (ОВ) на основе монокристаллов типа силленитов [3].

Исследование ФИП при комнатной температуре в монокристаллических пленочных световодах $\text{Bi}_{12}\text{TiO}_{20} : \text{Fe}$ [3] ранее позволило нам определить спектральную зависимость ФИП, его зависимость от соотношения интенсивностей засвечивающего и считающего излучения, а также обнаружить фотоиндукционное нелинейное пропускание ОВ $\text{Bi}_{12}\text{TiO}_{20}$ [4].

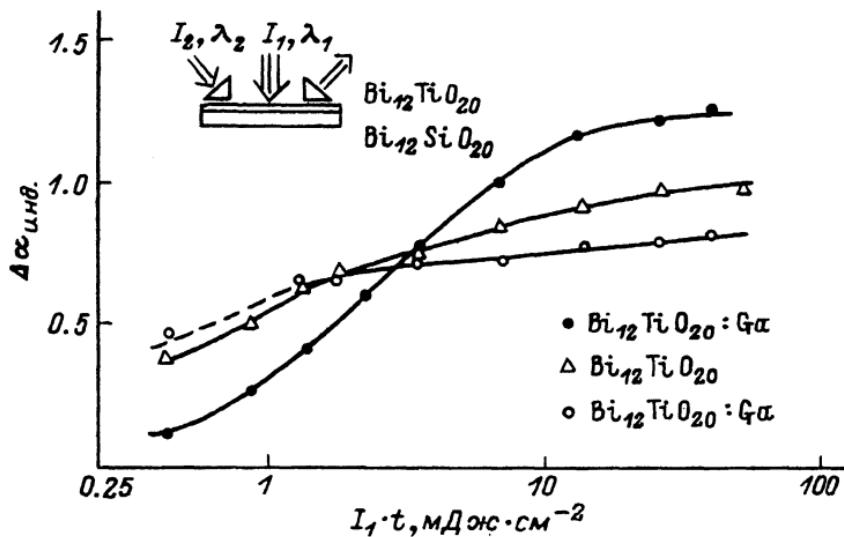


Рис. 1. $\lambda_1 = 0.4\text{--}0.48 \text{ мкм}$, $\lambda_2 = 0.63 \text{ мкм}$, $I_2 = 60 \text{ мВт}\cdot\text{см}^{-2}$.

В настоящей работе были исследованы фотоиндуцированные изменения коэффициента поглощения в планарных ОВ из $Bi_{12}TiO_{20}$, легированных Ga и Ca , а также в специально нелегированных ОВ. Волноводы были изготовлены методом жидкофазной эпитаксии на подложках из $Bi_{12}SiO_{20}$ [5]. Выбранные волноводные структуры обладали собственными оптическими потерями $0.7\text{--}1 \text{ см}^{-1}$ при толщине эпитаксиального слоя $\sim 30 \text{ мкм}$ для всех образцов и отличались легирующим элементом (Ca , Ga). Рентгеноструктурный анализ исследуемых образцов показал достаточную монокристалличность сформированных эпитаксиальных пленок [5].

В экспериментах засвет ОВ осуществлялся нормально их плоскости излучением сине-зеленой области спектра, диаметр пятна засвета составлял $\sim 0.55 \text{ см}$, длина волны зондирующего излучения $- 0.63 \text{ мкм}$. Значения коэффициента ФИП ($\Delta\alpha_{\text{инд}}$) определялись по изменению интенсивности проходящего света [3]. Нами были исследованы зависимости величины $\Delta\alpha_{\text{инд}}$ от величины предварительной экспозиции $I_1 \cdot t$ волноводных структур, а также кинетика коэффициента $\Delta\alpha_{\text{инд}}$ при одновременном поступлении на пленку считающего и засвечивающего пучков.

На рис. 1 представлены экспериментально полученные зависимости коэффициента $\Delta\alpha_{\text{инд}}$ от экспозиции $I_1 \cdot t$ ($\lambda_1 = 0.4\text{--}0.48 \text{ мкм}$) для ОВ $Bi_{12}TiO_{20}$, легированных Ga , Ca и специально нелегированного волновода. Врезка на рис. 1 иллюстрирует использованную геометрию эксперимента. Как видно из представленных зависимостей, легирование Ga уменьшает ФИП при экспозициях до $2.5 \text{ мДж}\cdot\text{см}^{-2}$ и увеличивает его при больших экспозициях, легирование Ca , наоборот, несколько повышает ФИП при малых и уменьшает его при больших экспозициях. Зависимости $\Delta\alpha_{\text{инд}} = f(I_1 \cdot t)$ для всех образцов имеют насыщающийся характер, но различаются наклоном линейного участка. При $I_1 \cdot t \approx 2.5 \text{ мДж}\cdot\text{см}^{-2}$ значение $\Delta\alpha$ для всех исследуемых структур составляет $\approx 0.7 \text{ см}^{-1}$. Ана-

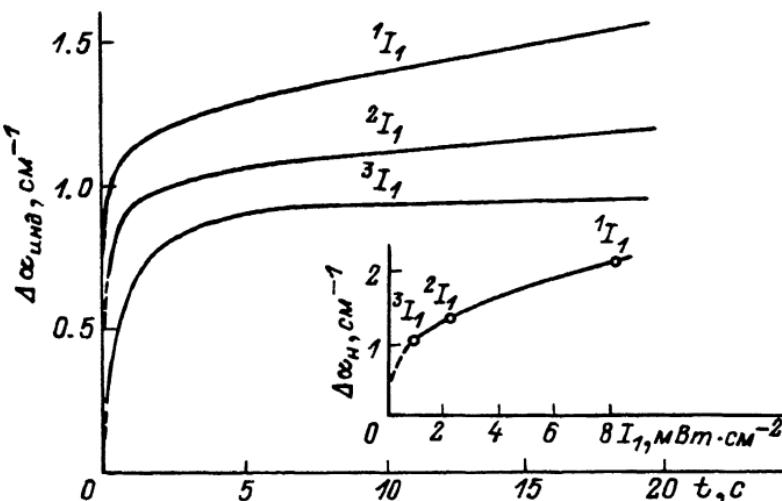


Рис. 2. Кинетические зависимости фотоиндуцированного коэффициента поглощения для оптического волновода $\text{Bi}_{12}\text{TiO}_{20}$: Ca ; $\lambda_1 = 0.4\text{--}0.48 \text{ мкм}$, $\lambda_2 = 0.63 \text{ мкм}$, $I_2 = 2.4 \text{ мВт}\cdot\text{см}^{-2}$.

логичные зависимости, полученные при экспонировании образцов различными линиями излучения аргонового лазера, имеют тот же характер. Однако в этом случае зависимости $\Delta\alpha_{\text{инд}} = f(I_1, t)$ практически линейны в диапазоне $0.002\text{--}1 \text{ Дж}\cdot\text{см}^{-2}$, что говорит о логарифмическом характере зависимости величины индуцированного поглощения от экспозиции. Различный наклон зависимостей определяется отличием лигатуры образцов.

На рис. 2 представлены временные зависимости $\Delta\alpha_{\text{инд}}$ для ОВ $\text{Bi}_{12}\text{TiO}_{20}$: Ca при различных значениях интенсивностей засвета I_1 , включаемого в момент времени $t = 0$. Представленные зависимости также имеют насыщающийся характер, при этом можно выделить быстровременную ($t < 10^{-1} \text{ с}$) и „долговременную“ ($t > 1 \text{ с}$) составляющие зависимостей $\Delta\alpha_{\text{инд}}(t)$, обусловленные, вероятно, сложным характером установления динамического равновесия энергетических уровней в запрещенной зоне $\text{Bi}_{12}\text{TiO}_{20}$ при включении засвета.

Полученные экспериментальные результаты соответствуют процессу перезаселения энергетических уровней, расположенных в запрещенной зоне монокристаллов типа силленитов [3, 6]. В работе [3] для двухуровневой модели было получено выражение, характеризующее зависимость $\Delta\alpha_{\text{инд}}$ от соотношения интенсивностей I_1 и I_2 при $I_1 \gg I_2$:

$$\Delta\alpha_{\text{инд}} = \sigma M_2 \left[1 - \left(\frac{I_2}{\sigma I_1} \right)^2 \right], \quad (1)$$

где σ – сечение оптического поглощения, M_2 – концентрации энергетических уровней, расположенных на $\Delta E_2 \approx \frac{1.24}{\lambda_2}$ (эВ) от дна зоны

проводимости, γ — отношение вероятности захвата электрона из зоны проводимости на уровень с ΔE_2 к вероятности захвата на уровень с $\Delta E_1 = \frac{1.24}{\lambda}$ (эВ).

Это соотношение позволяет определить величину δM_2 при $I_2 \rightarrow 0$ либо при $I_1 \rightarrow \infty$. Предельно большие значения интенсивностей засвета I_1 , соответствуют также и экспозициям засвета, при которых наблюдается насыщение зависимости $\Delta \alpha_{\text{инд}} = f(I_1 \cdot t)$ (рис. 1). Например, для оптических волноводов $\text{Bi}_{12}\text{TiO}_{20} : \text{Ga}$ насыщение наблюдается при $I_1 \cdot t > 1 \text{ Дж} \cdot \text{см}^{-2}$ ($I_2 = 2.4 \text{ мВт} \cdot \text{см}^{-2}$) и составляет $\Delta \alpha_H = 2.1 \text{ см}^{-1}$, что соответствует величине $\Delta \alpha_{\text{инд}}$ при $I_2 \rightarrow 0$.

Решая в квазистационарном приближении систему кинетических уравнений, описывающих процесс перезарядки глубоких примесных центров [7] для $I_1 \gg I_2$, можно получить:

$$\Delta \alpha_{\text{инд}} = \delta M_2 (1 - e^{-AI_1 \cdot t}), \quad (2)$$

где A — величина, характеризующая параметры системы энергетических уровней запрещенной зоны рассматриваемых монокристаллов. Полученное соотношение (2) находится в качественном согласии с ходом экспериментальной зависимости $\Delta \alpha_{\text{инд}}$ (рис. 2). Однако из экспериментальных зависимостей $\Delta \alpha_{\text{инд}} = f(t)$ для различных интенсивностей засвета I_1 (врезка, рис. 2, а) видно, что $\Delta \alpha_H$ (при $t \rightarrow \infty$) зависит от I_1 , что не согласуется с выражением (2). По-видимому, это обусловлено изменением концентрации уровней M_2 в $\text{Bi}_{12}\text{TiO}_{20}$ под действием засветки, связанное с трансформацией системы энергетических уровней, расположенных в запрещенной зоне [8]. При этом процесс образования новых энергетических уровней (и изменение величины M_2 в двухуровневой модели, см. (2)) отражается в быстровременной составляющей экспериментальной зависимости $\Delta \alpha_{\text{инд}} = f(t)$ (рис. 2, кривая 1, $t < 10^{-1} \text{ с}$) с последующим „долговременным“ заполнением уровней новой энергетической системы электронами из зоны проводимости. Кроме того, возникновение фотоиндуцированного поглощения при используемой волноводной геометрии ($\Delta \alpha_{\text{инд}} \approx 2.1 \text{ см}^{-1}$) несомненно подвержено влиянию процессов, связанных с поверхностными состояниями энергетической системы пленочных структур на основе силланитов.

Выводы

1. При создании оптических устройств записи и обработки информации на основе монокристалла $\text{Bi}_{12}\text{TiO}_{20}$, легированного Ca , Ga , необходимо учитывать различный характер влияния легирующих примесей в разных диапазонах интенсивности записывающего света.

2. Для кинетической зависимости $\Delta \alpha_{\text{инд}}(t)$ наблюдается быстровременная составляющая фотоиндуцированного коэффициента поглощения, при этом индуцированное поглощение может достигать $\Delta \alpha_{\text{инд}} \approx 0.8 \text{ см}^{-1}$ за $t \leq 10^{-1} \text{ с}$.

3. Легирование Ga ОВ $\text{Bi}_{12}\text{TiO}_{20}$ уменьшает $\Delta \alpha_{\text{инд}}$ при экспозициях до $2.5 \text{ мДж} \cdot \text{см}^{-2}$ и увеличивает его при больших экс-

позициях, легирование Ca , наоборот, несколько повышает $\alpha_{\text{лиq}}$ при малых и уменьшает его при больших экспозициях.

В заключение авторы благодарят С.Э. Хабарова за предоставление образцов.

Список литературы

- [1] Tada K., Ku h a r a Y., Tatsu m i M., Yamaguchi T. // Appl. Opt. 1982. V. 21. N 16. P. 2953–2959.
- [2] Петров М.П., Степанов С.И., Хоменко А.В. Фоточувствительные оптические среды в голограммии и оптической обработке информации. Л., 1983. 269 с.
- [3] Леонов Е.И., Хабаров С.Э., Липовский А.А., Абусев В.М. // ЖТФ. 1988. Т. 58. В. 11. С. 2181–2186.
- [4] Абусев В.М., Леонов Е.И., Липовский А.А., Хабаров С.Э. // Письма в ЖТФ. 1987. Т. 13. В. 20. С. 1268–1270.
- [5] Бондарев А.Д., Кацавец Н.И., Кудрик И.Е., Леонов Е.И., Хабаров С.Э. // Письма в ЖТФ. 1985. Т. 11. В. 12. С. 713–717.
- [6] Камшилин , Петров М.П. // ФТТ. 1981. Т. 23. В. 10. С. 3110–3116.
- [7] Фридкин В.М. Физические основы электрофотографического процесса. М., 1966. 288 с.
- [8] Гусев В.А., Детиненко В.А., Соколов А.П. // Автометрия. 1983. В. 5. С. 34–44.
- [9] Гудаев О.А., Гусев В.А., Детиненко В.А., Елисеев А.П., Малиновский К. // Автометрия. 1981. В. 5. С. 38–47.

Поступило в Редакцию
7 марта 1989 г.